PAT-NO:

JP404006274A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04006274 A

TITLE:

DIAMOND COATING DEVICE

PUBN-DATE:

January 10, 1992

INVENTOR - INFORMATION: NAME NISHIMURA, KAZUHITO MATSUMOTO, YASUSHI

ASSIGNEE - INFORMATION:

NAME

OSAKA DIAMOND IND CO LTD

COUNTRY

A/N

APPL-NO: JP02109908

APPL-DATE:

April 25, 1990

INT-CL (IPC): C23C016/26, C23C016/44 , C30B029/04

US-CL-CURRENT: 118/724

ABSTRACT:

PURPOSE: To form the thin film of diamond over the entire surface of a hard

material to be treated by disposing a filament for heating gaseous raw

materials on the surface of the material to be treated and rotating and moving

the supporting base of the material to be treated at the time of forming the

thin film of the diamond by a chemical vapor phase method on the surface of the

hard material having a three-dimensional shape.

CONSTITUTION: The polygonal hard material to be treated is mounted on the

supporting base 12 in an upper chamber 1 and is lowered into the lower chamber.

After the chamber is hermetically closed, the inside of the lower chamber is

evacuated to a high vacuum degree by a vacuum pump 29. The filament 15 made of

a W wire for heating the gaseous raw materials is provided on the outer

periphery of the material to be treated mounted to the supporting base 12. A

gaseous mixture composed of gaseous methane and gaseous hydrogen is supplied

from a gas introducing port 28 into the chamber and while the supporting base

12 is vertically moved and rotated by motors 25, 25', the filament 35 is

energized to heat the gaseous raw material on the surface of the material to be

treated to ≥ 2000° C. The gaseous methane separates C by making chemical

reaction with the gaseous hydrogen at a high temp. and uniformly coats the

entire surface of the polygonal object to be treated with the thin film of the diamond.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

m 特許出願公開

平4-6274 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月10日

C 23 C 16/26 16/44 C 30 B

29/04

8722-4K 8722-4K

Ţ 7158-4G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

69発明の名称

ダイヤモンド被覆装置

②)特 願 平2-109908

寧

願 平2(1990)4月25日 22出

個発 明 西 者

仁

大阪府堺市鳳北町2丁80番地 大阪ダイヤモンド工業株式

会社内

個発 明 考 松 大阪府堺市風北町2丁80番地 大阪ダイヤモンド工業株式

会社内

大阪ダイヤモンド工業 他出 願人

大阪府堺市鳳北町2丁80番地

株式会社

弁理士 青木 秀寶 個代 理 人

1. 発明の名称

ダイヤモンド被覆装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 排気装置とガス供給装置が連結されたチャン パーを設け、該チャンパー内に該チャンパー外部 に配置された支持台上下機構及び回転機構に連結 された支持杆の一端をチャンパーを貫通して突出 させ、能支持杆の先端に支持台を取り付け、設支 持台を取り囲み、原料ガスを加熱する熱電子放射 用フィッメントを配置したことを特徴とするダイ ヤモンド被覆装置。
- 3. 数服の詳細な難照

[産業上の利用分野]

本発明は、例えば銅、超硬製の測定子、切刃 片、摺動片その他の耐磨部品等の表面に、ダイヤ モンドの薄膜を化学気相法で析出させるためのダ イヤモンド被覆装置に関するものである。

【従来技術と問題点】

ダイヤモンドを化学気相法で折出させる方法及

び 装 置 に つ い て 特 公 昭 58-27753号 公 報 に 記 載 さ れ ている。前記公報に記載される装置は、炭化水素 と水素との混合ガスを1000℃以上に加熱した熱電 子放射材によって予備加熱した後、この加熱混合 ガスを500~1300℃に加熱した基板表面に導入 して炭化水素の熱分解によりダイヤモンドを折出 させる構成をなすものであるが、被加工物品を置 く支持台は固定的であり、平板形状を有する被加 工物品の表面には均一にダイヤモンドの膜を析出 させることができるが、立体形状を有する被加工 物品の表面にダイヤモンドの膜を析出させること は困難であった。

[発明の構成]

本発明は前記立体形状を有する被加工物品の表 面に均一にダイヤモンドの膜を折出できるように 構成したダイヤモンド被覆装置にあり、基本的に は、前記物品を装置チャンパー内で支持する支持 台をチャンパー外より連結する支持杆により上下 動作ならびに回転動作できるようにし、この支持 台を取り囲んで炭化水紫と水素等よりなる原料ガ

スを加熱する熱電子放射用フィラメントを配電したものである。

以下図面に示す実施例により本発明を説明する.

第 1 図 (f) は正面パネルをはずした図を示し、同 (p) は側面パネルをはずし、一部断面を示した図である。

図示のようにチャンパーは、上よりチャンパー 1、チャンパー2、チャンパー3と前記チャン パー3に対する下部フランジ4により各チャン パー接合部をシールして結合され、前記チャン パー2とチャンパー3の結合位置のフランジ下面 で架台5上に載置して固定される。なお、6、 7、8、は正面、側面及び裏板パネルをそれぞれ 示す。

前記チャンパー1は外チャンパー1aと内チャンパー1bの二重構造になっており、内外チャンパーの作る空間は冷却水を循環できる構成をなし、作業中周囲温度を一定に保つようにする。また、チャンパー1の内外チャンパー1a、1bの壁を貫通し

また、前記支持台12を取り囲んで、チャンパー 1bの底面上に耐熱性絶縁物よりなる複数本の支柱 34を固定し、各支柱34の間において上下で機方向 に耐熱性絶縁物よりなる薬34′を固定し、前記 上下の架34′を支持点として支持台12の上下方 て、正面及び側面に監視窓33が設けられ、内チャンパー1bの天井には遮断板19が取り付けられ、チャンパー3(下段チャンパー)の外間部にはヒータ、熱電対等に対する導体を挿入し、また炭化水素、水業等をチャンパー内に導入する複数のポート28が設けられている。

前記チャンバー3の下側となる下部フランジ4の中心を貫通して、支持杯21が配置される。支持杯21が配置される。支持杯21と下部フランジ4との間はシール部材22により三重にシールされる。前記支持杯21はそのではおいて、支持台回転機構3とまれるが、支持台上下機構10は前台上下機構10は前台上下機構10は前台上下機構10は前台上下機構10は前台上下機構10は前台上下機構10は前台上下機構10は平行に配置されたねじ杆23とこのねじ杆23に銀合した可動案内部24と前記は下25、ねじ杆23は下部フランジ4より下方に伸びた支持杯26で支持され、前記の下方に伸びた支持杯26で支持され、前記の下方に伸びた支持杯26で

向において原料ガスを加熱する無電子放射用の例えばタングステンフィラメント35を直列に懸果して原料ガス加熱部を形成する。図示していないが、上側の集34′間に同様フィラメント35を張り、天井側でも加熱できるようにすることもできる。

図の実施例では前記フィラメント35により支持台12は四角状に取り囲まれることになるが、第2図に示すようにフィラメント35を環状に配置することもでき、電源端子36、36'に電源(図示していない)を接続する。

フィラメント35は上下の環状の始熱性絶縁架34'において上下折返しで縦方向に直列関係で支持される。この場合、環状に配置されたフィラメント35を分割して、電源切替えによって、部分的に通電できるようにし、被加工物品のダイヤモンド被膜対象面に合わせるように原料ガス加熱都を形成することもできる。

前記原料ガス加熱部の綴方向の高さは、かならずしも被加工物品を高さを完全に覆う必要はな

い。本発明では、支持台12が上下できるので、これによって十分被加工物品を覆って均一な温度に保つことができ、該表面に一様にダイヤモンドを析出できる。

3 24 9

また架 34'を多段として、フィラメント 35を上下多段に分割通電するように構成することもできる。

更に、前記チャンパー1は架台5の上面で支持 された支持棒20およびこの支持棒20と平行に乗車 に延びる架台5と一体のL型支柱11により、係合配 チャンパー1の上部の一端より突出させた形成した 1、1の上部の一端より突出させた形成した 1、27および下部より突出させた保合部27に形成した 1、1の記を支持棒20を通し、前記し型支柱11の先端 (丁度前記的り金具30と前記し型支柱11の先端 (丁度前記的り金具30の直上位置)および折れ の他端にパランサー14を取り付け、ワイヤー32の 先端をチャンパー1の釣金具30と結ぶ。この必 な構成を採ることにより、チャンパー1と2の連 結を解き、パランサー14を下降させることにより

とっており、これと同時に、支持台12を上下に移動させ、また回転を与えることによって、立体形状を有する被加工物品の表面が均一に保たれ、全面にわたってダイヤモンドを一様に折出させることができる。

[黎 果]

第1 図 (1) は本発明実施例の正面図、同 (11) は一部断面で示す前記実施例の側面図である。 チャンパー1を開放することができる。

排気装置は真空ポンプ 29、これと接続されるフレキシブルチューブ (ステンレス型)17に し型パルプ 18を介在させ、フランジ 4 の底部でチャンパー 3 に通じる。真空ポンプ (ロータリーポンプ)29による真空到速度は 5×10⁻³Torrである。

[操作]

チャンパー1を上方に上げ、被加工物を支持台12上に載置し、チャンパー1を下降して密封状態となし、チャンパー内を所定の圧力とし、被加工物を例えば800でに加熱し、タングステンフィラメントの温度を2000でとし、原料ガス、例えばメタンと水業をポート28から、チャンパー内に導入して被加工物面上にダイヤモンド数粒を析出させる。

[作用]

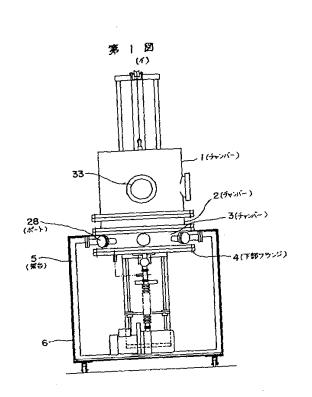
前述のように本装置では、被加工物品の形状に対し、原料ガス、例えば炭化水素と水業との混合ガスを加熱する熱電子放射用のフィラメントを被加工物品の立体形状面に一様に及ぶような配置を

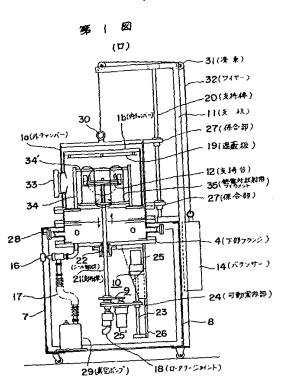
第2図は、本発明装置において適用される無電子 放射用フィラメントによる原料ガス加熱部の一例 を示す。

1、2、3 … チャンパー、4 … 下部フランジ、5 … 架合、9 … 試料台回転機構、10 … 試料台上下機構、11 … 支柱、12 … 支持台、14 … パランサー、15 … ロータリーポンプ、16 … L型パルブ、17 … フレキシブルチューブ、18 … ロータリジョイント、19 … 遠蔽板、20 … 支持律、21 … 支持杆、22 … シール部材、23 … ねじ杆、24 … 可動案内部、25、25′ … モーター、28 … 支持材、27 … 保合物、28 … ポート、29 … ロータリーポンプ、30 … 釣り金具、31 … 滑車、32 … ワイヤー、33 … 監視窓、34 … 耐熱器性支柱、34′ … 耐熱器解性架、35 … フィラメント。

代理人 弁理士 青木秀實績

特開平4-6274(4)





第 2 図

